

Nanometrics 和 Rudolph 宣布合并

来源：半导体观察

日前，领先的制程控制计量和软件分析供应商 Nanometrics Incorporated，以及半导体制程控制系统、光刻设备、晶圆厂和先进封装设备软件领先供应商 Rudolph Technologies 宣布，两家公司将合并。合并后的公司将成为半导体行业和其他先进市场首选的端到端计量，检测，制程控制软件和光刻设备供应商。

资料显示，Nanometrics 公司提供自动测量系统，用于计量光学关键尺寸(OCD)量测、薄膜测量以及晶圆应力在电晶体及交互运作下的测量应用和 Lynx 平台，能使集群计量工厂自动化可应用于晶圆计量。如光学关键尺寸的测量和薄膜工序的控制。此外，Nanometrics 自动和整合系统还用于多种工序控制上，包括尺寸和薄膜厚度测量、地型测量装置、缺陷检测和覆盖登记，以及用于薄膜各种性质分析上，如其光学，电学及材料等。

Nanometrics 工序控制解决方案部署于生产工序上，从前端的基板制造到大批量的半导体和其他装置的生产，以及到晶圆级封装的应用工序皆有之。Nanometrics 公司直接或透过代工厂商管道，销售其测量和检测系统予半导体制造商和设备供应商，以及高亮度的 LED、太阳能光伏、资料储存装置、硅晶圆和光罩等制造商。

Rudolph Technologies, Inc. 成立于 1940 年，总部设在的 Wilmington，他们设计、开发、制造和支持应用在微电子设施制造中的过程控制缺陷之检测和测量、先进封装光刻技术、数据分析系统和软件等。该公司还提供晶圆制程及后段制造良率管理解决方案，用在晶圆加工和最终制造，透过独立系统提供缺陷检测、光刻、探针卡测试及分析、薄膜测量等。该公司的过程控制软件解决方案，目的是在提高两次运转对比控制、故障检测、分类和自动化工具等，此外并提供备件。

此次合并将两家高度互补的领先半导体检测和计量公司联合起来。

文章收入时间：2019-06-26